

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11309404 A

(43) Date of publication of application: 09.11.99

(51) Int. CI

**B05C 11/08** 

C23C 26/02

G02F 1/13

G03F 7/30

H01L 21/027

H01L 21/306

// C23F 1/08

(21) Application number: 10121282

(22) Date of filing: 30.04.98

(71) Applicant:

TOSHIBA CORP

(72) Inventor:

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

GOTO JUICHI

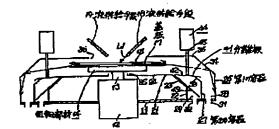
YAMABE SUMISHIGE

#### (54) SUBSTRATE TREATING DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a substrate treating device by which different waste treated liquids can be classified and recovered.

SOLUTION: Against a substrate 17 subjected to rotary driving by a rotary chuck 14, a liquid chemical discharge nozzle 18 for discharging liquid chemical 11 and a pure water discharge nozzle 19 for discharging pure water for washing are provided. Around the rotary chuck 14, an outer cup 26 for recovering waste liquid chemical splashed from the substrate 17 is provided. Inside the outer cup 26, an inner cup 27 for recovering waste washing liquid splashed from the substrate 17 is provided. The inner cup 27 is provided with a separation plate 41 freely rotatably in the up and down directions. The separation plate 41 is moved to such a position that the waste liquid chemical splashed from the substrate 17 is passed to recover it in the outer cup 26, and receives the waste washing liquid splashed from the substrate 17 to recover it in the inner cup 27.



### (19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-309404

(43)公開日 平成11年(1999)11月9日

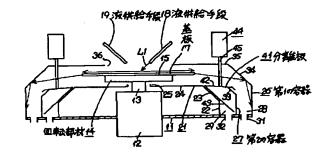
	識別記号		FΙ				
11/08			B05C	11/08			
26/02	,		C 2 3 C	26/02			
1/13	101		G02F	1/13		101	
7/30	501		G03F	7/30		<b>501</b>	
21/027			C 2 3 F	1/08		101	
		審査請求	未請求 請求	東項の数11	OL	(全 11 頁)	最終頁に続く
(21)出顧番号 特願平10-121282			(71)出願人 000003078 株式会社東芝				
(22)出顧日	平成10年(1998) 4月30日		神奈川県川崎市幸区堀川町72番地				
			(72)発明	者後藤	<del>劳</del>		
							50番地 株式会
			(72)発明	者 山辺	純成		
				神奈川	県横浜	市磯子区新磯	子町33番地 株
				式会社	東芝生	產技術研究所	内
			(74)代理				
			I				
	26/02 1/13 7/30 21/027	11/08 26/02 1/13 1 0 1 7/30 5 0 1 21/027 特願平10-121282	11/08 26/02 1/13 1 0 1 7/30 5 0 1 21/027 審查請求	11/08	11/08 B 0 5 C 11/08 C 26/02 C 2 3 C 26/02 1/13 1 0 1 G 0 2 F 1/13 7/30 5 0 1 G 0 3 F 7/30 C 2 3 F 1/08 審査請求 未請求 請求項の数11	11/08	11/08

#### (54) 【発明の名称】 基板処理装置

#### (57)【要約】

【課題】 異なる処理廃液の区分回収を可能とする基板 処理装置を提供する。

【解決手段】 回転チャック14により回転駆動する基板17に対し、薬液L1を吐出する薬液吐出ノズル18と、水洗用の純水L2を吐出する純水吐出ノズル19とを設ける。回転チャック14の周囲に、基板17より飛散した薬液廃液を回収する外カップ26を設ける。外カップ26の内側に、基板17より飛散した水洗廃液を回収する内カップ27を設ける。内カップ27にて分離板41を上下方向へ移動自在に設ける。分離板41は、基板17より飛散した薬液廃液を通過させる位置に移動して外カップ26に回収し、基板17より飛散した水洗廃液を受け止めて内カップ27に回収する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板を支持して回転する回転部材と、回転部材により回転駆動される基板に第1の液および第2の液を供給する液供給手段と、

回転部材の周囲に設けられ基板より振り切られた一方の 液を回収する第1の容器および基板より振り切られた他 方の液を回収する第2の容器と、

前記第1の容器および第2の容器と前記基板との間に設けられ前記第1の液および第2の液の回収途中経路を前記第1の容器および第2の容器のいずれか一方に選択的 10 に切り替える分離板とを具備したことを特徴とする基板処理装置。

【請求項2】 分離板は、上昇して第1の容器を密閉するとともに、下降して第2の容器を密閉することを特徴とする請求項1記載の基板処理装置。

【請求項3】 分離板は、第1の容器および第2の容器の上部開口に上下動自在に嵌合された筒形の蓋体と一体に動作するように形成されたことを特徴とする請求項1記載の基板処理装置。

【請求項4】 分離板は、第2の容器の上端部を支点に、第1の容器を密閉する方向と第2の容器を密閉する方向とに開閉可能に設けられたことを特徴とする請求項1記載の基板処理装置。

【請求項5】 分離板は、上昇して第1の容器を密閉するとともに、下降して第1の容器を開□することを特徴とする請求項1記載の基板処理装置。

【請求項6】 第1の容器の内側に第2の容器が設けられたことを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の基板処理装置。

【請求項7】 基板を支持して回転する回転部材と、 回転部材により回転駆動される基板に第1の液および第 2の液を供給する液供給手段と、

回転部材に設けられた一方の液を溜める凹部と、

凹部から一方の液を排出する液排出手段と、

回転部材の周囲に設けられ基板より回転部材の外周へ振り切られた他方の液を回収する容器とを具備したことを 特徴とする基板処理装置。

【請求項8】 凹部は、回転部材の中央部に設けられ、 液排出手段は、

凹部に設けられた液排出溝と、

液排出溝に接続されて回転部材を回転駆動する中空回転 軸とを具備したことを特徴とする請求項7記載の基板処 理装置。

【請求項9】 凹部は、回転部材の偏心部に設けられ、 液排出手段は、

凹部に設けられた液排出溝と、

被排出溝の下側に配置された回収管とを具備したことを 特徴とする請求項7記載の基板処理装置。

【請求項10】 凹部の液排出溝に開閉自在に設けられた弁体と、

弁体を開閉操作する開閉手段とを具備したことを特徴と する請求項8または9記載の基板処理装置。

【請求項11】 液排出手段は、

凹部に挿入された回収管と、

回収管中に設けられた吸込用ポンプとを具備したことを 特徴とする請求項7記載の基板処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば液晶ディスプレーに用いられるガラス基板などの上に形成された薄膜を薬液により現像処理したり、例えば半導体ウェハに用いるケイ素基板を清浄化するためにエッチング処理したり、あるいはコーティング材をコーティング処理する場合に用いられる基板処理装置に関する。

[0002]

【従来の技術】図18は、従来の基板処理装置の薬液処理部断面図を示す。

【0003】との図にて、薬液吐出ノズル1および純水 吐出ノズル2が基板3上に配置されており、基板3は回 転チャック4上に真空吸着により保持されている。回転 チャック4はモータ5により回転駆動され、基板3は任 意の回転速度で回転する。

【0004】基板3の回転中に基板3の中心に向けて薬液および純水が吐出され、基板3上の全面に広げられる。

【0005】基板3の周囲は、固定されたカップ6で覆われており、基板3上に吐出された薬液あるいは純水を外部に飛散させないよう回収し、排液配管7を介し回収タンク(図示せず)に排出し、分離処理する。

0 【0006】薬液処理シーケンスについて説明する。被 処理体である薄膜を形成された基板3を回転チャック4 に真空吸着により保持した後、100r.p.m.程度で回転 させる。

【0007】基板3の回転中に、薬液吐出ノズル1より 薬液が基板3の中央部に吐出され、基板全面に一様に広 げられる。

【0008】薬液は、基板3に沿って周囲に振り切られ、カップ6の内壁に衝突して落下し、カップ6の下部に溜まり、排液配管7に流れ込み、回収タンク(図示せず)に排出される。

【0009】基板3の薬液処理が終わった後、基板3を再度100r.p.m.で回転させ、純水吐出ノズル2より純水を吐出し、薬液処理を停止させるため純水置換する。

【0010】純水は、薬液と同様に振り切られて、カップ6の下部に集められ、同様に回収タンクに排出される。

【0011】置換終了後、純水の供給を停止し、基板3を2000r.p.m.で高速回転し、乾燥させる。この際、振り切られた純水も同様に回収タンクに排出される。

50 【0012】薬液廃液は濃度が高いため、酸アルカリ排

---

3

水に使用する廃液処理設備で中和処理される。

【0013】との廃液処理は生産規模に比例して容量が大きくなり、回収に要する費用も高額になる。それゆえ、薬液廃液量を極力少なくする必要がある。

【0014】廃液量の削減対策として、薬液および純水の使用量の削減、薬液と純水との分離が考えられる。

【0015】薬液は、置換に必要な純水が混入すると、 処理速度の低下などによる薄膜残りで製品に大きな影響 を与える。故に使用量の削減以上に、薬液廃液中の純水 を分離することが重要である。

【0016】しかし、薬液処理後すぐに純水置換しなければ、処理むらが発生し、処理後のパターン線幅が面内で不均一になるため、同一のカップ6内で薬液処理から純水置換まで行なう必要がある。

【0017】その場合、カップ6に接続された排液配管7を、処理シーケンスに従って2系統に切り替える方法も考えられるが、カップ6の下部で液溜まりが生じるため、この部分で純水と薬液とが混ざり、分離不可能である。

#### [0018]

【発明が解決しようとする課題】以上述べたように、薬 <u>被処理の直後に純水置換を行う場合は、廃液を薬液廃液</u> と純水とに分離することが困難であり、多量の廃液を回 収処理することになるなどの問題がある。

【0019】本発明は、とのような点に鑑みなされたもので、異なる処理廃液の区分回収を可能とする基板処理 装置を提供することを目的とするものである。

#### [0020]

【課題を解決するための手段】本発明の基板処理装置は、基板を支持して回転する回転部材と、回転部材によ 30 り回転駆動される基板に第1の液および第2の液を供給する液供給手段と、回転部材の周囲に設けられ基板より振り切られた一方の液を回収する第1の容器および基板より振り切られた他方の液を回収する第2の容器と、前記第1の容器および第2の容器と前記基板との間に設けられ前記第1の液および第2の液の回収途中経路を前記第1の容器および第2の容器のいずれか一方に選択的に切り替える分離板とを具備したものである。

【0021】これにより、分離板を基板より振り切られた一方の液を通過させる位置に移動するのみで一方の液 40を第1の容器に容易に区分回収でき、また、分離板を基板より振り切られた他方の液を受け止める位置に移動するのみで他方の液を第2の容器に容易に区分回収できる。

【0022】分離板は、上昇して第1の容器を密閉するとともに、下降して第2の容器を密閉するものである。 【0023】これにより、第1および第2の容器の一方で液を回収するときは、第1および第2の容器の他方への液の侵入を確実に防止できる。

【0024】分離板は、第1の容器および第2の容器の 50

上部開口に上下動自在に嵌合された筒形の蓋体と一体に 動作するように形成されたものでも良い。

【0025】これにより、蓋体の上下動とともに移動する分離板により第1の容器への区分回収と第2の容器への区分回収とを容易に選択できる。

【0026】分離板は、第2の容器の上端部を支点に、 第1の容器を密閉する方向と第2の容器を密閉する方向 とに開閉可能に設けられたものでも良い。

【0027】これにより、第2の容器の上端部を支点に 開閉可能の分離板を僅かに作動させるだけで、第1の容器への区分回収と第2の容器への区分回収とを短時間で 選択できる。

【0028】分離板は、上昇して第1の容器を密閉するとともに、下降して第1の容器を開口するものでも良い。

【0029】これにより、分離板が下降したときは、基板より振り切られた一方の液を第1の容器に区分回収でき、また、分離板が上昇したときは、基板より振り切られた他方の液が第1の容器に侵入するおそれを確実に防20 止できる。

【0030】第2の容器は、第1の容器の内側に設けると良い。

【0031】これにより、分離板で第1の容器への回収途中経路を開くのみで一方の液を第1の容器に回収でき、閉じるのみで他方の液を第2の容器に回収できる。

【0032】また、本発明の基板処理装置は、基板を支持して回転する回転部材と、回転部材により回転駆動される基板に第1の液および第2の液を供給する液供給手段と、回転部材に設けられた一方の液を溜める凹部と、

四部から一方の液を排出する液排出手段と、回転部材の 周囲に設けられ基板より回転部材の外周へ振り切られた 他方の液を回収する容器とを具備したものである。

【0033】これにより、回転部材の凹部に溜まった一方の液を液排出手段により回収でき、また、基板より回転部材の周囲に振り切られた他方の液を一つの容器で区分回収できる。

【0034】凹部は、回転部材の中央部に設けられ、液排出手段は、凹部に設けられた液排出溝と、液排出溝に接続されて回転部材を回転駆動する中空回転軸とを具備したものである。

【0035】とれにより、回転部材を回転駆動する中空 回転軸を、液排出手段としても用いるから、構造の簡略 化を図れる。

【0036】凹部は、回転部材の偏心部に設けられ、液 排出手段は、凹部に設けられた液排出溝と、液排出溝の 下側に配置された回収管とを具備したものでも良い。

【0037】これにより、回転部材の偏心部の任意の位置に複数の液排出手段を設けることが可能となり、凹部 に溜まった液を短時間で排出できる。

【0038】凹部の液排出溝に開閉自在に設けられた弁

4

体と、弁体を開閉操作する開閉手段とを具備したもので も良い。

【0039】これにより、一方の液に他方の液が混入す るおそれを弁体で確実に防止できるとともに、開閉手段 により弁体を開いて凹部に溜まった液を排出できる。

【0040】液排出手段は、凹部に挿入された回収管 と、回収管中に設けられた吸込用ポンプとを具備したも のでも良い。

【0041】これにより、凹部に溜まった液を吸込用ボ ンプにより回収管を経て任意の高さに排出できる。 [0042]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る基板処理装置 を図1万至図17に示された種々の実施形態を参照しな がら説明する。

【0043】図1および図2は、本発明に係る基板処理 装置の第1実施形態を示し、これらの図において、11は ベースであり、このベース11の中央部にモータ12の本体 部が固定され、モータ12の回転軸13に回転部材としての 回転チャック14がその中央部で一体的に取付けられてい

【0044】前記モータ12は、その回転軸13の回転速度 を可変制御できるものである。また、前記回転チャック 14は、上面に基板吸着部15が設けられ、この基板吸着部 15にて、例えば液晶ディスプレーに用いられるガラス基 板などの基板17を真空吸着して保持する。

【0045】との基板17上には、第1の液としての<u>薬液</u> (現像液など) L1を供給する液供給手段としての薬液吐 出ノズル18と、第2の液としての純水12を供給する液供 給手段としての純水吐出ノズル19とがそれぞれ配置され ており、それぞれのノズル先端開口は基板17の中心に向 30 けてセットされている。

【0046】ベース11から回転チャック14のネック部と なる回転軸13の外周部にわたって整流板21が設けられて

【0047】この整流板21には、筒状の立上部22と斜面 部23と水平面部24と内筒部25とが連続的に形成され、回 転された基板17から振り切られた一方の処理廃液である 薬液廃液、または他方の処理廃液である水洗廃液がモー タ12側へ侵入するおそれを、水平面部24および内筒部25 により防止し、また、斜面部23および立上部22により下 40 方へ落下する廃液流れを円滑に案内する。

【0048】さらに、ベース11の周縁部に、第1の容器 としての外カップ26と、第2の容器としての内カップ27 とが回転軸13を中心に同心状に固定されている。これら の外カップ26および内カップ27は、回転チャック14の近 くに位置する内カップ27を、回転チャック14から遠くに 位置する外カップ26が覆う形状に設けられている。

【0049】そして、これらの外カップ26および内カッ プ27により、外側に位置する第1の回収室28と、内側に の周囲にて遠近方向に区画形成され、これらの回収室2 8、29により、基板17より振り切られた薬液廃液および 水洗廃液を区分回収する。

【0050】外カップ26の下部内側には、外側の回収室 28に連通された排液配管31が接続され、また、内カップ 27の下部内側には、内側の回収室29に連通された排水配 管32が接続されている。内カップ27の上端縁部33は、内 側に向って傾斜状に折曲形成されている。

【0051】また、外カップ26の上部には、内カップ27 の上端縁部33と等しい勾配の外側斜板部34と、水平板部 35とが連続形成され、さらに、その水平板部35の中央部 に、前記薬液吐出ノズル18および純水吐出ノズル19と対 向する開口部36が形成されている。

【0052】内カップ27の上部には、分離板41が移動自 在に設けられている。との分離板41は、図1に示される ように基板17より振り切られた液を通過させる位置に移 動して外カップ26に回収するとともに、図2に示される ように基板より振り切られた液を受け止めて内カップ27 に回収するもので、ほぼ水平に設けられた一方の閉板部 42と、この閉板部42に対し傾斜状に設けられた他方の閉 板部43とが鋭角に一体化された形状に形成されている。 【0053】外カップ26またはベース11などに流体圧シ リンダ44のシリンダ本体が固定され、この流体圧シリン ダ44のピストンロッド45の先端に分離板41の閉板部42が 接続され、流体圧シリンダ44により上下駆動される。

【0054】図1に示されるように、分離板41は、下降 時に整流板21の斜面部23に密着する。この時、基板17か ら振り切られた廃液は飛散により外カップ26まで流れ、 外カップ26内の回収室28に回収される。

【0055】一方、図2に示されるように、分離板41が 基板髙さより髙い位置に上昇した場合は、基板17より振 り切られた液は分離板41の閉板部43の側壁まで飛散して 衝突するか、あるいは整流板21に沿って流れ、内カップ 27内の回収室29に回収されるようになっている。

【0056】次に、図1および図2に示された第1実施 形態における薬液処理シーケンスについて説明する。

【0057】例えば、主表面にレジストが塗布された液 晶表示装置用の500mm×600mmの矩形のガラス基板 17を回転チャック14に保持した後、基板17を100r.p. m.で回転させ、薬液吐出ノズル18よりレジストを現像処 理する薬液を吐出する。この時、分離板41は下降してい る。基板17上に薬液を広げ、薬液処理を行う。

【0058】一定時間、薬液処理を行った後、基板17を 500r.p.m.で2秒間回転させ、基板17上に乗った薬液 を振り切る。との時に生じる一方の処理廃液である薬液 廃液は、全て外カップ26に回収され、排液配管31を介し て薬液廃液用回収タンクに廃液される。

【0059】次に基板17を100r.p.m.に減速させ、分 離板41を上昇させる。上昇後、純水吐出ノズル19より純 位置する第2の回収室29とが、それぞれ回転チャック14 50 水の吐出を開始し、基板17上に残った薬液を純水で置換 10

する。この置換後、純水の吐出を停止し、基板17を20 00r.p.m.で高速回転し、乾燥させる。

【0060】これらの水洗時および乾燥時に生じる他方の処理廃液である水洗廃液は、分離板41の閉板部43の側壁まで飛散して衝突し、内カップ27内に回収され、排水配管32により水洗廃液として建屋処理施設に排水される。

【0061】とのように、分離板41を上下動させて、外カップ26と内カップ27とを切り替えることにより、薬液廃液と水洗廃液とを完全に切り分けることができる。 【0062】その際、薬液振り切りから分離板41の上昇までに要する時間は1秒程度である。その間、基板17は半乾燥状態で放置されるが、薬液むらが生じる場合は、分離板41を上昇させて振り切りを行う時に、同時に純水を吐出することによって回避できる。

【0063】とれにより薬液廃液が純水に混ざり、水洗 廃液中の薬液濃度が増えるが、置換に使用する純水使用 量全体の10分の1以下の増加であるため、従来技術の 薬液廃液および水洗廃液を回収する方法と比較すると、 改善効果は十分ある。

【0064】以上のように、薬液及び純水の排水を回収 し廃液するカップを多重に設けることにより、各々のカップは完全に分離されており回収した廃液は混ざらない ようになっている。

【0065】次に、分離板41の作用を説明すると、内カップ27に位置する分離板41は基板17に対し相対的に高さを変えることができ、分離板41が基板高さより高い位置にある場合は、振り切られた液は分離板41の側壁に衝突し、その側壁に沿ってカップ下部に落下し、溜まるようになる。一方、分離板41が基板高さより低い位置に移動した場合は、振り切られた液は内カップ27を越えて外カップ26の側壁に衝突し、外カップ26の下部に溜まるようになる。

【0066】とのように、分離板41を上下に動かすことにより容易に廃液分離が可能であり、また、この切り替えを薬液の振り切り処理と純水置換処理との間に行うことにより、薬液廃液と水洗(置換)廃液とを確実に分離できる。

【0067】分離板41の下降に要する時間は、やはり 0.5~1秒程であり、カップ外で置換を行う場合の基 40 板の移載に要する時間に比べ、20分の1に短くでき る。これにより、薬液むらの発生を防止でき、また薬液 廃液と水洗廃液とを各々別の外カップ26および内カップ 27に溜めるため、混ざることなく確実に分離できる。

【0068】特に、図1および図2に示された分離板41は、上昇して一方の閉板部42が外カップ26の水平板部35に密着するとともに、他方の閉板部43が内カップ27の上端縁部33に密着するから、外カップ26を密閉でき、また、下降して一方の閉板部42が内カップ27の上端縁部33に密着するとともに、他方の閉板部43が整流板21の斜面 50

部23に密着するから、内カップ27を密閉でき、とのため、外カップ26および内カップ27の一方で液を回収するときは、外カップ26および内カップ27の他方への液の侵入を確実に防止できる。

【0069】次に、図3および図4を参照しながら、本発明に係る基板処理装置の第2実施形態を説明する。なお、図1および図2に示された実施形態と同様の部分には同一符号を付して、その説明を省略する。

【0070】第1の容器としての外カップ26の上部開口51から第2の容器としての内カップ27の上部開口52にわたって、筒形の蓋体53が上下動自在に嵌合され、との蓋体53に蓋連動遮蔽型の分離板54が連続的に形成されている。

【0071】また、ベース11上に流体圧シリンダ55のシリンダ本体が設置され、この流体圧シリンダ55のピストンロッド56に支持部材57を介して蓋体53の上面部が連結され、流体圧シリンダ55により蓋体53とともに分離板54が上下動可能に設けられている。

【0072】そして、図3に示されるように、流体圧シリンダ55により蓋体53とともに分離板54を上方へ移動すると、基板17から振り切られた薬剤廃液は、分離板54と内カップ27との間を通過し、外カップ26の側壁まで飛散してその側壁に衝突し、外カップ26内に回収される。

【0073】一方、図4に示されるように、流体圧シリンダ55により蓋体53とともに分離板54を内カップ27の内側に嵌合するまで下方へ移動すると、基板17から振り切られた水洗廃液は、分離板54まで飛散して分離板54の側壁に衝突し、内カップ27内に回収される。

【0074】このように、蓋体53と一体の分離板54により外カップ26内への区分回収と、内カップ27内への区分回収とを容易に選択できる。

【0075】次に、図5および図6を参照しながら、本発明に係る基板処理装置の第3実施形態を説明する。なお、図1および図2に示された実施形態と同様の部分には同一符号を付して、その説明を省略する。

【0076】第2の容器としての内カップ27の上端縁部33の上端部にヒンジ61が設けられ、このヒンジ61を支点に跳ね上げ型の分離板62が開閉可能に設けられている。

【0077】この分離板62には、外カップ26またはベース11などに取付けられた流体圧シリンダ44のピストンロッド45の先端がピン63により連結され、この流体圧シリンダ44により、分離板62は、外カップ26を密閉する方向と、内カップ27を密閉する方向とに作動される。

【0078】そして、図5に示されるように、流体圧シリンダ44により分離板62を下方へ回動して、分離板62の 先端部を整流板21の水平面部24に密着させると、基板17 から振り切られた薬剤廃液は、分離板62の上方を通過 し、外カップ26の側壁まで飛散してその側壁に衝突し、 外カップ26内に回収される。

io 【0079】一方、図6に示されるように、流体圧シリ

8

ンダ44により分離板62を上方へ回動して、分離板62の先 端部を外カップ26の水平板部35に当接すると、基板17か ら振り切られた水洗廃液は、分離板62まで飛散して分離 板62の側壁に衝突し、内カップ27内に回収される。

【0080】この場合、流体圧シリンダ44は、内カップ 27の上端部を支点に分離板62を僅かに開閉作動させるだ けで、外カップ26への区分回収と内カップ27への区分回 収とを短時間で選択できる。

【0081】次に、図7および図8を参照しながら、本 発明に係る基板処理装置の第4実施形態を説明する。な 10 お、図1および図2に示された実施形態と同様の部分に は同一符号を付して、その説明を省略する。

【0082】整流板21の斜面部23と第1の容器としての 外カップ26の水平板部35との間で、傾斜状に形成された 分離板64が上下動自在に設けられている。

【0083】との分離板64には、前記流体圧シリンダ44 のピストンロッド45の先端が連結され、この流体圧シリ ンダ44により、分離板64は、上昇して外カップ26を密閉 するとともに、下降して外カップ26を開口する。

【0084】すなわち、図7に示されるように分離板64 20 が下降したときは、基板17より振り切られた薬液廃液 を、内カップ27の上方で通過させて外カップ26内に区分 回収でき、また、図8に示されるように分離板64が上昇 したときは、基板17より振り切られた水洗廃液を、分離 板64の側壁に衝突させて内カップ27内に回収し、外カッ プ26内に侵入するおそれを確実に防止できる。

【0085】以上のように、分離板41,54,62,64によ り液の回収途中経路を切り替える分離回収方式は、例え ば基板あるいはカップを上下動させる分離回収方式に比 べて、回収途中経路の切り替えを短時間で、入力的にも 容易に行える。

【0086】そして、回収途中経路の切り替えを短時間 で行えることから、処理された基板の品質を高めること ができ、例えば、薬液むらの発生を防止できる。

【0087】なお、前記各実施形態では、薬液11による 薬液廃液を外カップ26で回収し、純水L2による水洗廃液 を内カップ27で回収しているが、これに限定されるもの ではなく、例えば、薬液L1による薬液廃液を内カップ27 で回収し、純水L2による水洗廃液を外カップ26で回収す るように、分離板41,54,62,64を制御しても良い。

【0088】次に、図9乃至図11は、本発明に係る基 板処理装置の第5実施形態を示し、これらの図におい て、71はベースであり、このベース71上に、回転速度を 可変制御できるモータスの本体部が固定されている。と のモータ72は、中空回転軸73を有し、この中空回転軸73 の上端部に回転部材としての回転チャック74が、その中 央部で一体的に取付けられている。

【0089】この回転チャック74は、急勾配の傾斜部75 と綴勾配の傾斜部76とにより凹形の容器(皿)状または ロート状に形成され、この回転チャック74の中央部が最 50

も深くなるように、回転チャック74の内部に液を溜める 凹部77が形成されている。

【0090】回転チャック74の上面には複数のスペーサ ピン78が設けられ、このスペーサピン78にて、例えば液 晶ディスプレーに用いられるガラス基板などの基板17 が、回転チャック74の上面と密着しないように保持され る。

【0091】 この基板17上には、第1の液としての薬液 (現像液など) L1を供給する液供給手段としての薬液吐 出ノズル18と、第2の液としての純水L2を供給する液供 給手段としての純水吐出ノズル19とがそれぞれ配置され ており、それぞれのノズル先端開口は基板17の中心に向 けてセットされている。

【0092】前記凹部77の中央部には、この凹部77から 液を排出する液排出手段81が設けられている。

【0093】この液排出手段81は、ロート状に形成され た回転チャック74の最下部に中空回転軸73が配設され、 回転チャック74の凹部77亿て最も低位に位置する中央部 に、図10に示されるように半球形の液排出溝82が設け られ、この液排出溝82に中空回転軸73の内孔83が連通さ れ、さらに、凹部77の液排出溝82には、回収制御バルブ である球形の弁体84が嵌脱自在かつ開閉自在に設けら れ、この弁体84に対し、弁体84を開閉操作する開閉手段 としてのブッシャピン85が設けられている。

【0094】とのブッシャピン85は、中空回転軸73の内 孔83亿上下動自在に遊嵌され、このブッシャピン85の上 端が弁体84の下面に対し弁体84を押上可能に対向され、 また、ブッシャピン85の下端部は、図示されない流体圧 シリンダなどにより上下動可能に設けられている。

【0095】また、ベース71から、回転チャック74のネ ック部となる中空回転軸73の外周部にわたって整流板91 が設けられている。

【0096】この整流板91には、筒状の立上部92と斜面 部93と水平面部94と内筒部95とが連続的に形成され、回 転された基板17から振り切られた薬液廃液または水洗廃 液がモータ72側へ侵入するおそれを水平面部94および内 筒部95により防止し、また、斜面部93および立上部92に より下方へ落下する廃液流れを円滑に案内する。

【0097】さらに、この整流板91の外周部にてベース 40 71上に、基板17より回転チャック74の外周へ振り切られ た液を回収する容器としてのカップ96が、回転チャック 74の外周を覆うように設けられている。

【0098】このカップ96と前記整流板91との間には、 基板17より回転チャック74の外周へ振り切られた液を回 収する回収室97が設けられている。

【0099】カップ96の下部内側には、回収室97に連通 された排水配管98が接続され、またカップ96の上部中央 には、前記薬液吐出ノズル18および純水吐出ノズル19が 挿入される開口部99が形成されている。

【0100】なお、前記弁体84は、必ずしもボール状で

30

なくても良く、例えば板状でも良い。さらに、弁体84の 開閉手段は、ブッシャビン85に限定されるものでもな く、ブッシャピン85以外の開閉手段としては、例えば、 圧搾空気を吹き込むエアブローや、あるいは弁体84を耐 薬品コートの施された鉄球などで形成して、電磁石によ り開閉するようにしても良い。

【0101】次に、図10および図11を用いて、回転 チャック74の中空回転軸73より液を回収する作用を説明 する。

【0102】図10に示されるように、薬液処理時や終 了時には、ブッシャピン85の押上作用により、中空回転 軸73上にあるボール状の弁体84を液排出溝82内から押し 開き、回転チャック74の凹部77内に溜まっている薬液廃 液を、中空回転軸73の内孔83を通じて外部の薬液廃液用 回収タンク(図示せず)に排出する。

【0103】一方、図11に示されるように、水洗時に は、ブッシャピン85を下降させて、その押上作用を解除 することにより、弁体84を自重により液排出溝82内に戻 して、中空回転軸73上の上端開口を閉止しながら、回転 チャック74の遠心力で基板17から振り切られた水洗廃液 20 を、回転チャック74の周囲に飛散させて、カップ96内の 回収室97に回収する。

【0104】次に、図9乃至図11に示された実施形態 における薬液処理シーケンスについて説明する。

【0105】基板17を回転チャック74で保持した後、基 板17を100r.p.m.で回転させ、薬液吐出ノズル18より 薬液L1を基板17の中央部へ吐出し、基板17上に薬液を広 げ、基板17に塗布された感光剤を現像処理するなどの薬 液処理を行う。

【0106】との時、回収用の弁体84は、図10に示さ れるようにブッシャビン85の押上作用により開いている から、薬液廃液は中空回転軸73の内孔83を経て、図示さ れない薬液廃液用回収タンクに回収される。

【0107】一定時間、薬液処理を行った後、ブッシャ ピン85の下降により弁体84を閉めて、基板17を500r. p.m.で2秒間回転させ、基板17上に乗っている薬液を振 り切るが、ほとんどの薬液廃液は、既に中空回転軸73を 経て薬液廃液用回収タンクに回収されている。

【0108】次に基板を300r.p.m.に減速させ、純水 吐出ノズル19より基板17上への純水L2の吐出を開始し、 基板17上に残った薬液を純水で置換する水洗処理を行 う。

【0109】との純水置換後、純水L2の吐出を停止し、 基板17を2000r.p.m.で髙速回転させて乾燥させる。 【0110】とれらの水洗時および乾燥時の水洗廃液 は、回転チャック74の液排出溝82を弁体84により閉じて いるため中空回転軸73の内孔83には排出されず、回転チ ャック74の凹部77内から遠心力により回転チャック74の 周囲に飛散し、最大でもカップ96の側壁に衝突してカッ ブ96内の回収室97に回収され、排水配管98より水洗廃液 50 流体圧シリンダなどにより上下動される。

として建屋処理施設に排水される。

【0111】 このように、中空回転軸73上の弁体84をプ ッシャピン85の上下動で切り替えることにより、回収す る薬液廃液と水洗廃液とを確実に切り分けることができ るとともに、図18に示された現状の単カップ方式で も、大きな改造をせずに優れた薬液分離を行える。

【0112】また、回転チャック74を回転駆動する中空 回転軸73を液排出手段81として用い、回転チャック74の 凹部77に溜まろうとする薬液廃液を中空回転軸73により 回収し、また、基板17より回転チャック74の外周へ振り 切られた水洗廃水を一つのカップ96で区分回収するか ら、構造の簡略化を図れる。

【0113】さらに、ブッシャピン85による弁体84の開 閉操作により、凹部77に溜まった薬液廃液と水洗廃液と の排出経路を確実に切り替えることができ、薬液廃液が 水洗廃液に混入するおそれを確実に防止できる。

【0114】次に、図12乃至図14を参照しながら、 本発明に係る基板処理装置の第6実施形態を説明する。 なお、図9乃至図11に示された実施形態と同様の部分 には同一符号を付して、その説明を省略する。

【0115】ベース71上に固定されたモータアは、通常 の中実の回転軸73を有し、この回転軸73の上端部に、回 転部材としての回転チャック101 が、その中央部で一体 的に取付けられている。

【0116】との回転チャック101は、緩勾配の中高状 の中央部102 と、急勾配の周縁傾斜部103 とにより、W 形断面の皿状に形成されている。よって、この回転チャ ック101 は、中央部より偏心部が最も深く形成され、と の偏心部に液を溜めるための凹部104 が設けられてい

【0117】この凹部104の任意の複数位置にて液を排 出するための複数の液排出手段105が設けられている。

【0118】 これらの液排出手段105 は、回転チャック 101 の凹部104 における最も低い位置の複数箇所に、図 13および図14に示されるように半球形の液排出溝10 6 が設けられ、この液排出溝106 の下側に液排出口部10 7 が突設され、さらに、この液排出口部107 の下側に円 環状樋形の液受部108 が配置され、この液受部108 の下 側に複数の回収管109 が接続されている。液受部108 お よび回収管109は、ベース71または整流板91の上部に取 付けられている。

【0119】また、回転チャック101の凹部104内に設 けられた前記半球形の液排出溝106には、回収制御バル ブである球形の弁体111 が嵌脱自在かつ開閉自在に設け られている。

【0120】さらに、前記回収管109 および液排出口部 107 に、図13 および図14に示されるように弁体111 を開閉操作する開閉手段としてのブッシャピン112 が遊 嵌されている。このプッシャピン112 は、図示されない

【0121】そして、薬液処理時や終了時には、W状断 面の回転チャック101 の最下部に位置する弁体111 を開 くことにより、基板から振り切られた薬液は、いったん 凹部104 内に溜った後、回収管109 などの液排出手段10 5 を経て排出され、薬液廃液用回収タンクに戻される。 複数の液排出手段105 は、薬液の流量が多い場合に適し ている。

【0122】また、純水による水洗時には、弁体111を 液排出溝106 に戻して、液排出手段105 を閉止するとと もに、前記実施形態のように薬液処理時より高速で回転 10 駆動される回転チャック101 内から遠心力で振り切られ た水洗水が、カップ96内に飛散され、排水配管98により 建屋処理施設に送られる。

【0123】 このように、弁体111 を切り替えることに より、回収される薬液廃液と水洗廃液とを切り分け、一 方の廃液に他方の廃液が混入するおそれを弁体111 で確 実に防止できるから、現状の単カップ方式でも大きな改 造をせずに藁液分離できる。

【0124】次に、図15および図16は、図12乃至 図14に示された第6実施形態における液排出手段105 の液排出口部107を変形した変形例を示し、回転チャッ ク101 の凹部104 における最も低い位置に、ほぼ凹形の 弁体遊嵌部113 が設けられ、この弁体遊嵌部113 の内部 に球形の弁体111 を横方向に遊動できる大きさの液排出 溝114 が形成されている。

【0125】さらに、弁体遊嵌部113の下部に傾斜部11 5 が形成され、前記液排出溝114 にて傾斜部115 の下降 側に弁座116 が設けられ、この弁座116 を経て液排出溝 114と連通する液排出口117が設けられている。

【0126】との液排出口117 より前記プッシャピン11 30 2 を挿入して、弁体111 を突き上げると、弁体111 は、 図15に示されるように右側へ移動して弁座116を開 き、液排出溝114を液排出口117に連通する。弁体111 は、この弁座116を開いているときも液排出溝114内に 保持される。

【0127】一方、ブッシャピン112 を下げると、弁体 111 は、図16に示されるように自重で傾斜部115を下 降して、弁座116を閉じる。

【0128】次に、図17を参照しながら、本発明に係 る基板処理装置の第7実施形態を説明する。なお、図1 2 に示された実施形態と同様の部分には同一符号を付し て、その説明を省略する。

【0129】W形断面の皿状に形成された回転チャック 101 は、中央部より偏心部に液を溜めるための凹部104 が設けられているが、液排出手段120 として、凹部104 の一部に回収管121 の先端部122 が挿入され、この回収 管121 に吸込用ポンプ123 の吸込口が接続されている。 この吸込用ポンプ123 の吐出口は、図示されない薬液廃 液用回収タンクに連通されている。

説明すると、薬液処理時や終了時には、基板17上から振 り切られた薬液廃液は、断面がW状になっている回転チ ャック101 の凹部104 に溜るため、この凹部104 の最下 部まで挿入された回収管121を通して、吸込用ポンプ123 により薬液廃液を吸引し、薬液廃液用回収タンクに戻

【0131】また、純水による水洗時には、回収管121 を回転チャック101 の凹部104 から退避させたり、吸込 用ポンプ123 を停止したり、回収管121 中に設けられた 開閉弁(図示せず)を閉じると、前記実施形態のように 薬液処理時より高速で回転駆動される回転チャック101 の遠心力で、回転チャック101 の凹部104 から振り切ら れた水洗廃液が、カップ96内に飛散され、排水配管98に より建屋処理施設に送られる。

【0132】この実施形態は、吸込用ポンプ123 などの 運転を切り替えるととにより、回収される薬液廃液と水 洗廃液とを切り分けることができるから、現状の単カッ ブ方式でも大きな改造をせずに薬液分離を行える。さら に、凹部104 に溜まった廃液を回収管121 および吸込用 ポンプ123 により任意の高さ位置へ排出できる。

【0133】以上の、図9乃至図17に示された装置 は、図18に示された現在使用の装置を容易に改造して 転用できる。

【0134】すなわち、従来のカップをそのまま用い て、回転チャック74, 101 などを交換するだけで、同一 カップ内で分離、置換処理を行えるようになり、カップ 外で置換処理を行う従来装置に比べ安く製作または改造 でき、処理時間も格段に短くできる。

【0135】これにより、薬液むらの発生も防止でき、 また薬液回収と水洗廃液は、各々別に回収されるため、 混ざることなく分離されて再使用できる。特に、薬液廃 液は、回収して処理することにより再使用でき、薬液廃 液として破棄する量を大幅に低減でき、設備のランニン グコストを大幅に低減できる。

【0136】さらに、回転チャック74, 101 は薬液が溜 まる容器状に形成されており、エッチング中やエッチン グ後に溜まっている薬液を回転チャック74、101 の中空 回転軸73や回収管109, 121 などより容易に回収でき

【0137】一方、水洗時は弁体84, 111 や吸込用ポン プ123 を閉止するように切り替え、回転チャック74. 10 1 を回転させることで、遠心力により振り切られた水洗 廃液がカップ96の側壁に衝突し、このカップ96の下部よ り排出される。

【0138】 このように、中空回転軸73や回収管109, 121 を配設することにより廃液分離を容易に可能とする とともに、その切り替えを、薬液の振り切り処理と純水 置換処理との間に短時間で行って、処理された基板の品 質を髙めることができる。

【0130】そして、この回収管121 による回収作用を 50 【0139】また、配管などに付着している微量の薬液

廃液が水洗廃液に混ざると、水洗廃液中の薬液濃度が増 えるおそれもあるが、置換に使用する純水使用量全体の 10分の1以下の増加であるため、従来技術の薬液廃液 および水洗廃液を回収する方法と比較すると、改善効果 は十分ある。

【0140】なお、本説明では、現像液と純水との組合 せを例にとり説明したが、この発明は、現像液と純水と の切り替えに限定されるものではなく、例えば複数のエ ッチング液の切り替えなどにも適用可能であることは言 うまでもない。

【0141】さらに、本説明では、液供給手段として先 端が開口した管状のノズル18、19の先端開口より薬液な どを吐出しているが、液供給手段は、この形態のノズル に限定されるものではなく、基板に対向して配されるシ ャワー吐出面に多数のシャワー吐出孔が穿設された面状 ノズルや、管の側面に多数のシャワー吐出孔が穿設され た直線状ノズルを基板面に沿って移動させる可動ノズル でも良い。

#### [0142]

【発明の効果】本発明によれば、異なる処理廃液を区分 20 回収して、それらの回収時の混合を防止できるから、各 処理廃液の回収効率を大幅に向上でき、廃液処理設備の ランニングコストを大幅に低減できる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る基板処理装置の第1実施形態を示 す分離板降下時の断面図である。

【図2】同上第1実施形態における分離板上昇時の断面 図である。

【図3】本発明に係る基板処理装置の第2実施形態を示 す分離板上昇時の断面図である。

【図4】同上第2実施形態における分離板降下時の断面 図である。

【図5】本発明に係る基板処理装置の第3実施形態を示 す分離板降下時の断面図である。

【図6】同上第3実施形態における分離板上昇時の断面 図である。

【図7】本発明に係る基板処理装置の第4実施形態を示 す分離板降下時の断面図である。

【図8】同上第4実施形態における分離板上昇時の断面

【図9】本発明に係る基板処理装置の第5実施形態を示\*

#### \* す断面図である。

【図10】同上第5実施形態における弁体開放時(薬液 回収時)の拡大断面図である。

【図11】同上第5実施形態における弁体閉止時(水洗 時)の拡大断面図である。

【図12】本発明に係る基板処理装置の第6実施形態を 示す断面図である。

【図13】同上第6実施形態における弁体開放時 (薬液 回収時)の拡大断面図である。

【図14】同上第6実施形態における弁体閉止時(水洗 10 時)の拡大断面図である。

【図15】同上第6実施形態における液排出手段の液排 出口部を変形した変形例を示す弁体開放時(薬液回収 時)の拡大断面図である。

【図16】同上変形例における弁体閉止時(水洗時)の 拡大断面図である。

【図17】本発明に係る基板処理装置の第7実施形態を 示す断面図である。

【図18】従来の基板処理装置を示す断面図である。 【符号の説明】

14, 74, 101 回転部材としての回転チャック

17

18 液供給手段としての薬液吐出ノズル

液供給手段としての純水吐出ノズル 19

第1の容器としての外カップ 26

第2の容器としての内カップ

41, 54, 62, 64 分離板

蓋体 53

73 中空回転軸

凹部 77, 104

> 液排出手段 81, 105, 120

82. 106 . 114 液排出溝

84, 111 弁体

85, 112 開閉手段としてのブッシャピン

96 容器としてのカップ

回収管 109

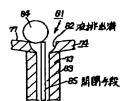
121 回収管

123 吸込用ポンプ

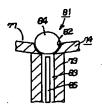
第1の液としての薬液 LI

40 12 第2の液としての純水

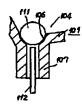
【図10】

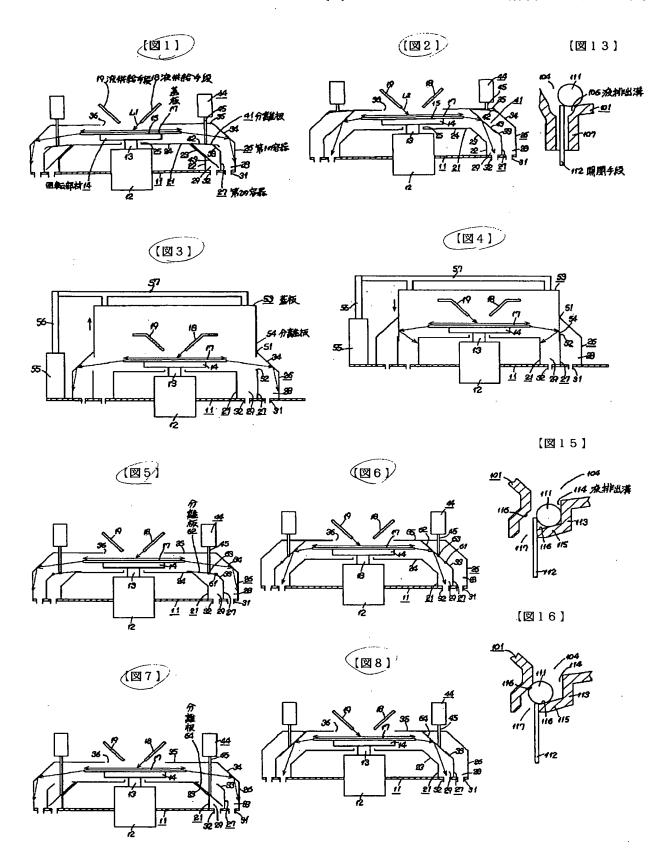


【図11】

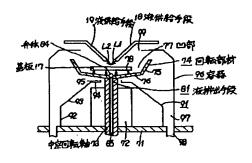


【図14】

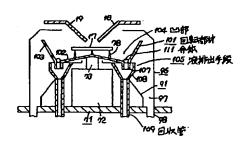




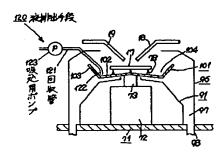
[図9]



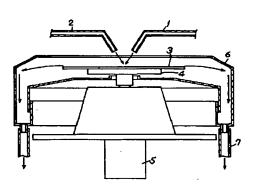
【図12】



[図17]



【図18】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

H01L 21/306

// C 2 3 F 1/08

101

FΙ

H 0 1 L 21/30

569C

21/306

1